

#### 99年度藥廠GMP國際化說明會

# 國內西藥廠實施PIC/SGMP現況

行政院衛生署食品藥物管理局 陳映樺 視察 99年10月20-21日

### 大綱



- □ 西藥製劑廠實施PIC/SGMP
- □ PIC/S GMP 符合性評鑑作業
- □ 100年度推動全面實施PIC/SGMP活動
- □結語





## 西藥製劑廠實施PIC/SGMP

- □ 西藥製劑廠實施GMP歷程
- □ 法規公告
- □ 實施PIC/SGMP之時程及配套措施

## 西藥製劑廠實施GMP歷程



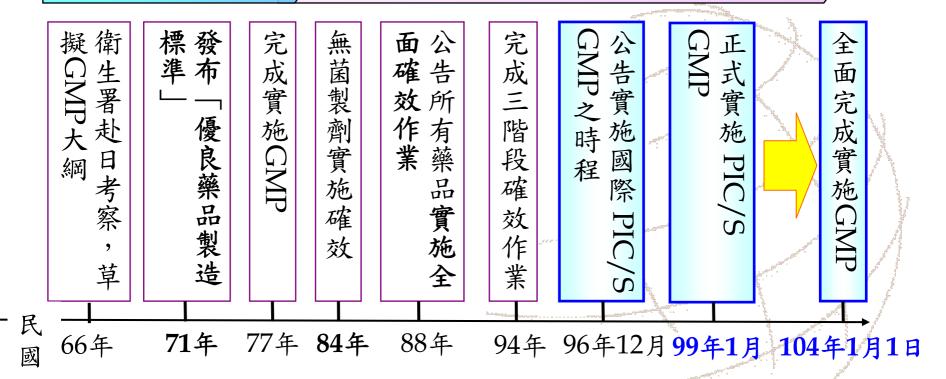
#### **GMP**

#### cGMP (current GMP)

確效作業

 $\rightarrow$ 

國際 GMP



## 實施PIC/SGMP之法規公告 CFDA



- □ 時程公告 (96.12.19 衛生署 署授食字第0961401849號公告)
  - ■自公告日起,新設、遷移、擴廠、復業、新增劑型及新 增加工品項,即應符合PIC/SGMP。
  - ■既有西藥製劑製造工廠,給予緩衝至98年12月31日止。 【99年1月1日正式開始實施】
  - ■國產與輸入藥品之西藥製劑廠同步實施。
- □ 配套措施公告(國產-98.7.30衛生署署授食字第0981401222號函)
- □ 標準公告 (96.08.30署授食字第0961401248號函)
  - ■「國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S)藥品優良製造規範 (總則與附則)」中英對照條文
- □修訂法源依據:藥物製造工廠設廠標準

#### 國內西藥製劑廠 實施國際PIC/S GMP時程與配套措施



後續查廠使用 PIC/S GMP標準 2年緩衝期 5年硬體配套 2007.12.19 2010.1.1 2015.1.1

類別		期間	缺失 改善		
	軟體	緩衝期	列缺失,廠商需提出改善報告,經審查後通過查核。		
時程	硬體	緩衝期	涉及廠房、設施、設備等列缺失,暫不列嚴重,廠商需於改善報告中提出 具體可行之改善計畫與時程,經認可後,最遲於103.12.31前改善完畢。	104.1.1 起全面 完成實 施	
	許可證	新申請案、言			



## 修訂PIC/S GMP法源依據



- □ 99.2.26 行政院衛生署、經濟部令 署授食字第099110269號、經工字第09904601110號
  - ■修正「藥物製造工廠設廠標準」部分條文
- □修正重點:
  - 第三篇 藥品優良製造規範
  - ■第一章 西藥藥品優良製造規範
    - 第34條 西藥藥品之製造、加工、分裝或包裝,依 國際醫藥品稽查協約組織有關藥品優良製造指 引(PIC/S: Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products)之規定。
  - ■第二章 中藥藥品優良製造規範 保留原有條文,刪除未使用之注射劑、生物製品、疫苗等條文。



## PIC/S GMP 符合性評鑑作業

- □ 全廠符合PIC/SGMP評鑑申請
- □ 全廠符合PIC/SGMP評鑑現況
- □ 常見PIC/S GMP查核缺失

# PIC/S GMP 符合性評鑑作業 FDA

#### 行政院衛生署藥物食品檢驗局 函

機關地址:11561 台北市南港區昆陽6

傳 真:

聯絡人及電話: 陳映樺 2653-1015

電子郵件信箱:5320cyh@nlfd.gov.tw

受文者:本局科技發展中心

發文日期:中華民國98年6月5日

發文字號:藥檢科字第0981400918號

速別:

密等及解密條件或保密期限:

附件:

主旨:為鼓勵藥廠符合國際GMP標準,對於自評全廠已符合PIC /S GMP之西藥製劑製造業者,可主動向本局申請PIC/S

GMP符合性之評鑑查核,敬請轉知所屬會員,請 查照。

說明:依據行政院衛生署96年12月19日署授食字第0961401849 號公告辦理。

正本:台灣區製藥工業同業公會

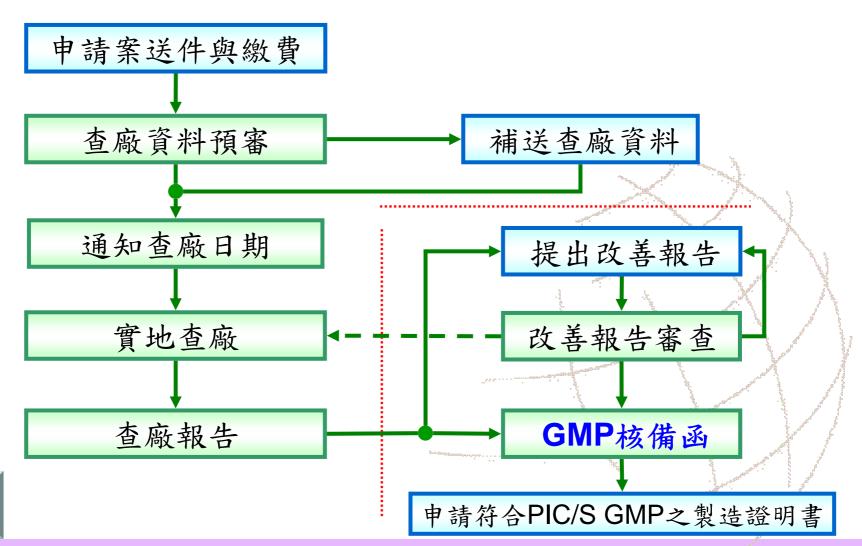
副本:行政院衛生署藥政處而政策

为物食品的糖

•自評全廠符合 PIC/S GMP

•主動提出申請

# PIC/S GMP 符合性評鑑作業 FDA





## 申請PIC/SGMP評鑑檢送資料 CFDA



- □ 申請公文函
- □藥品製造工廠GMP軟體評鑑申請表
- □ 評鑑費用:20,000元
- □ 檢送相關資料
  - ■工廠基本資料(Site Master File):一式3份及電子檔
  - ■廠內GMP相關標準作業程序(SOP)一覽表(一式3份)
  - ■製藥機器、設備及分析儀器一覽表 (一式3份)
  - ■最近3年廠內所有劑型實際生產之批次清單 (依劑型分列)

# 藥物製造工廠GMP軟體評鑑申請表CFDA

藥	廠	類	別	□製劑廠(□製劑廠□空膠囊廠□分、包裝廠□醫藥用氣體□其他	
エ	廠	名	稱		
エ	廠	地	址	Asylvin Asylvin .	食品藥物管理局
電			話	傳真	> 便民服務
	E-n	nail			>藥品GMP表單
負	亨		人	聯絡人	或
監	製	藥	師		> 業務專區 > 藥品
申	請	類	別	PIC/S GMP 符合性	>製藥工廠管理
評	鑑	費	用		> 申請表單
( -	<u> </u>	韦元	( ئ	in a desired framework has a second and the second	
注	意	事	項	藥廠應在操作中接受檢查,未有操作者,不予檢查。	and the second s

#### 檢送資料注意事項(1)

#### 製藥工廠基本資料 (Site Master File)

FDA

- □依公告格式撰寫,最新版本。
  - 下載:TFDA網頁>業務專區>藥品>製藥工廠管理 (GMP)>製藥工廠>稽查作業之附件
- □生產區圖示
  - 廠區平面圖:標示各建築物用途
  - ■製造區平面圖:標示各操作室用途及人、物流動線等
- □支援系統概述
  - ■空調系統配置圖
    - ●空氣處理單元之配置與供應區域
    - ●操作室潔淨度分級與空氣流向
  - ■水系統流程圖:各處理單元及管路流向簡圖

## 檢送資料注意事項(2)



- □最近3年廠內所有劑型實際生產之批次清單:
  - ■分別就「自行生產」、「委託製造」及「受託製造」,列出所有產品(含藥品許可證號)
  - ■依劑型排列
  - ■近3年有生產之品項,填寫最近3年生產之總批次。
  - ■近3年無生產之品項,則填寫未生產。
  - ■無菌製劑產品:備註欄加註為「無菌製備」或「最終滅菌」
  - ■分段製造者:備註欄列出生產階段別
- □全廠PIC/SGMP符合性評鑑查核之劑型認定原則
  - ■若劑型已超過3年未有實際生產事實者,則不予認定, 且需請廠方切結不生產。



## 全廠符合PIC/SGMP評鑑現況 CFDA



國內西藥製劑廠157家

統計至99.10.15

狀態	家數	%
提出 申請	28	17.8
通過評鑑	21	13.4
缺失 改善	6	
等待 查廠	1	

- □全廠通過PIC/S GMP 符合性評鑑的21家藥 廠中:
  - ■13家生產無菌製劑產品
  - ■11家生產特殊產品

產品類別	家數
青黴素&頭孢子	\s
 菌素類等抗生素	
女性荷爾蒙	4 /
 細胞毒類	4/

## 全廠符合PIC/S GMP評鑑



## 缺失統計

□ 缺失數

■平均:39項/廠次

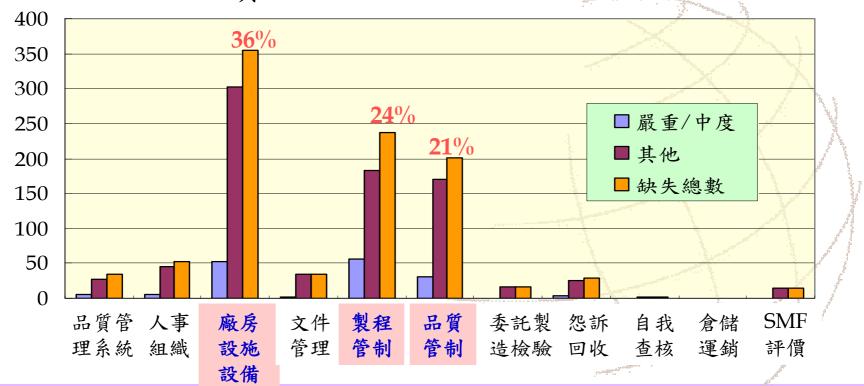
■min:5項

■max:95 項

□ 查核結果

■改善後再查:2廠

■改善後通過:19 廠





## 常見PIC/SGMP查核缺失

# 常見PIC/SGMP查核缺失(1) FDA

- □1.5 產品品質檢討 (Product Quality Review) 一切經許可的產品,含外銷專用產品,皆應執行 品質檢討。每年執行一次並加以文件化。
- □常見缺失
  - ■未包含PIC/SGMP總則1.5之所有項目
    - ●原物料使用與供應商狀態、分析方法改變、技術協議書之檢討、上市許可變更、安定性試驗結果
  - ■SOP未規範執行頻率;未納入所有生產批次
  - ■檢討結果,未有後續CAPA。

# 常見PIC/SGMP查核缺失(2)



#### 廠房設施設備

**3.12** 

生產區應有效通風,並備有適合於所處理的產 品、在該區域內所從事的作業,以及外在環境等 的空氣管控設施(包含溫度,必要時包含濕度與 過濾)

- □常見缺失
  - ■更衣室無回風口
  - 回風口位於天花板,廠內亦未證明通風之有效性。
  - ■高粉塵區域未配置集塵管

- 常見PIC/SGMP查核缺失(3)
- □ Annex 15-36~38,41,45 清潔確效;清潔前後之holding time評估
- □常見缺失
  - 未將所有與產品接觸設備表面之清潔方法納入清潔確效評估
    - •乾粉充填手套箱之手套清潔與滅菌程序,未執行清潔確效。
    - ●手動乾粉充填筆之抽真空導管未納入清潔確效評估。
  - 清潔確效採grouping方式,新產品加入時,未重新評估指標成分
  - 計畫書未說明應執行之批數及指標成份評估選訂原則,報告書亦 未註明執行之批號。
  - | 取樣點位置非最差狀況,且僅針對設備執行,連接之管線均未評 估。
  - 製造設備在使用與清潔間,以及在清潔與再使用間之時間間隔尚 未規範。時間間隔未予以確效。

- 常見PIC/SGMP查核缺失(4)
- **5.10** 在製程的每一階段,皆應防止產品及原物料受微生物及其 他污染。
- □常見缺失
  - 液劑、乳膏及軟膏的製造,製造現場微生物監控僅於每年之空調 系統驗證執行
  - 注射液劑瓶蓋之乾燥烘箱進氣空氣未經過濾。
  - 未確認透氣式乾燥機與膜衣機之外氣經機器本身之filter處理後之 空氣品質。
  - 洗淨室使用之抹布、透氣式顆粒乾燥機所用之布,為纖維釋出材
  - 原料取樣室,取樣器未適當儲存。
  - Ⅰ 製造現場PE瓶下料漏斗之上方及輸送帶未有保護裝置避免微生物 污染。
  - 【標示已清潔操作室,檯面上、風口上仍有粉末殘留。

## 常見PIC/SGMP查核缺失(5)



- □ 5.19 交叉污染應以適當的技術或組織的措施避免
- □ 5.20 應依規定的程序定期查核/核對防止交叉污染的措施 及其有效性。
- □常見缺失
  - ■尚未制訂防止交叉污染措施整體計畫。
  - 交叉污染之防治計畫未詳全
    - 細胞毒類及非細胞毒類產品,共用空調及泡殼包裝設備,雖以時段切 换方式進行生產,惟預防交叉污染措施僅有清潔確效。
    - 高致敏性等產品採自我圍堵,但共用物料倉儲 (例如:泡殼、膠 膜),生產後退料至主倉儲區,相關交叉污染防制未有評估。
    - ●各級區與非級區間未裝設壓差計監控。
    - 不同荷爾蒙產品生產作業間採切換時段生產,每次作業完成後之清潔 作業僅製程操作相關工作場所及走道,未包括淋浴間、更衣室、緩衝
  - ■交叉污染防治措施及其有效性未定期查核。

## 常見PIC/SGMP查核缺失(6)



**□** 5.24

製程和程序應經定期的關鍵性再確效,以確保其維持達成 預定結果的能力。

- □常見缺失
  - ■製程和程序未定期關鍵性再確效。
  - ■清潔之再確效尚未制訂頻率。
  - ■製程與程序之定期再確效作業訂有「再確效作業整體計畫 書」規範各確效事項經完成後每年應檢討一次,惟實際尚未 規劃執行。
  - 製程再確效採用產品品質評估之結果,惟評估後未制訂合格 標準。
  - ■製程和程序之定期的關鍵性再確效採用回溯性方式評估該產 品前4年之data,與"製程確效SOP"所述每3年再確效不一 致。

# 常見PIC/SGMP查核缺失(7)。FDA

- □ 6.23-6.32 持續進行之安定性計畫 (On-going Stability)
- □常見缺失
  - 對於注射液劑產品,廠內依配方分類,僅選擇各類配方內品質最易變化產品進行持續性安定性試驗。
  - 持續性安定性試驗計畫:
    - 每年之檢測未涵蓋各種包裝型態。
    - ◆未針對特殊情形(如重大變更、偏差、重製、收回作業等)納入追加之批次。
  - 無菌製劑產品之長期安定性試驗,最後一次未執行無菌試驗。
  - 用來執行持續安定性試驗產品之恆溫恆濕室未持續監控其溫濕度。
  - 趨勢分析發現異常情況,未調查、異常處理。

# 常見PIC/S GMP查核缺失(8) FDA

- □第七章 委/受託製造與委/受託檢驗
- □常見缺失
  - 委受託製造/檢驗合約書 (Technical Quality Agreement) 之內容尚未符合PIC/S第七章之相關要求。
  - 受託製造契約尚未納入產品技術相關事項之權責單位等事項。例如:原料採購、檢驗、放行、留樣品儲存、作業程序、通報作業等。
  - ■未規範受託者之相關怨訴與回收等事宜,回收作業的有效性 未定期予以評估。

【運銷紀錄由委託者保存,或可由委託者取得;有怨訴時可取的相關紀錄。應明訂於委託者回收SOP中(7.13)】

■委託檢驗未向主管機關申請核備。

## 常見PIC/S GMP查核缺失(9) 附則一:無菌產品製造



- □ (3)潔淨度分級Grade A、B、C、D
- □ (4~6)微粒子、微生物監測
- □常見缺失
  - 自動充填機之已滅菌vials瓶下料區與轉盤區上方未有層流空氣供應系統提供A級潔淨度環境
  - Capping區域未有A級空氣保護
  - 無菌製造區生產時之環境監測:
    - 微粒子連續監控在A級區之監控點未靠近充填點
    - A級區之落下菌監控點未評估是否具有代表性(未涵蓋人員介入較多之 區域)
    - 落下菌之監控時段未涵蓋無菌組裝作業
    - 監控數據或判定結果未檢附於批次中。
    - 未記錄浮游菌監控時間點,且未考量選擇人員介入之時間點監測。

### 常見PIC/SGMP查核缺失(10) 附則一:無菌產品製造



- □ (1.17)衣服之更換與洗滌應依循指定之書載程序,以將潔淨區衣著的污染或帶入潔淨區之污染物降至最低。
- □常見缺失
  - 更衣程序設計不當,未將造成潔淨區衣著的污染或帶入潔淨區之 污染物降至最低。
  - 自衣櫃拿出衣服、頭套、鞋套與口罩後,無適當位置供工作人員 放置,更衣過程無法確保無菌服潔淨度。
  - 更衣室之空氣流向由髒污區吹向乾淨區。
  - 無菌衣未評估可清潔及滅菌次數,及可維持無菌之有效期限。
  - 無菌衣之清洗、滅菌、使用次數未有相關紀錄。

## 常見PIC/SGMP查核缺失(11) 附則一:無菌產品製造



- □(30)應證明空氣流動的型態不會呈現污染的風險,例如,應小心確保空氣流動不會把來自於產生微粒之人員、作業或機器的微粒散佈到較高產品風險的區域。
- □常見缺失
  - ■無菌製造場所未測試空氣流動型態。
  - ■乾粉自動作業充填機(配備水平層流裝置),人員於層流空氣上游處執行相關介入作業,是否會提高產品遭受污染之風險,未有相關空氣流動型態之證明。
  - ■A、B級區之空氣流向測試,僅於出風口及回風口進行 測試,室內空氣流向未經確認。

## 常見PIC/SGMP查核缺失(12) 附則一:無菌產品製造



- □(42)無菌作業的確效 (Media fill)
- □常見缺失
  - ■未有worse case(如試驗用管瓶與安瓶之容量及型號、 充填速度等)之相關評估。
  - ■未模擬正常生產及最差狀況之各項介入、或介入頻率、時間未詳加制訂。
    - ●執行Media fill未模擬最長充填時間。
    - ◆未模擬開門、維修及機器調整等"介入"動作,及介入之頻率、時間等。
  - ■未執行污染之調查
  - Media fill之微粒子監控僅有「靜態」之檢測資料。

## 查廠缺失改善



- □軟體相關缺失之改善
  - ■偏差/異常之通報、調查、評估等紀錄
  - ■SOP之制定或修訂
  - CAPA 、教育訓練
- □硬體相關缺失之改善
  - ■具體計畫書(含驗證、變更管制等)
  - ■實際改善之結果
  - ■相關 SOP、紀錄與報告(如校正、驗證、確效等)
- □應檢附具體改善證據